次世代タンデム太陽電池

GaInNAsSb で理想構造を実現 格子整合系4接合タンデム太陽電池

単一の半導体太陽電池の変換効率としては、薄膜 GaAs セルの 28.8%, Si 単結晶セルの 25.0%が報告さ れている^[1]。しかしながら、幅広いエネルギー分布を 持つ太陽光をエネルギー変換する場合には熱損失と 透過損失のトレードオフの関係により、理論的な最大 変換効率は 30%程度に制限されてしまう。したがって、 大幅な高効率化を実現するためには複数のエネル ギー帯に分離して、熱損失と透過損失を最小化させ つつエネルギー変換する工夫が必要となる。

太陽電池の高効率化のための最も成功している有 効な手法として、図1に示すようにバンドギャップの異 なる太陽電池を積層させた多接合型太陽電池 (タン デム太陽電池),および光学レンズなどの集光系によ って得られる高密度の太陽エネルギーを利用して発 電する集光型太陽電池が挙げられる。タンデム太陽 電池は光の入射側からワイドギャップ→ナローギャッ プとなるように複数の太陽電池を積層することにより, 上のサブセルで吸収されない透過光を下部のセルで 吸収することができる。また,サブセル間は直列に接 続されているため、タンデム太陽電池全体の電流は 各サブセルから取り出される電流の内の最小値に律 速され, 電圧は各サブセルの電圧の和となる。地上 用集光型太陽電池生産の主流である GaInP/GaInAs /Ge 格子整合系 3 接合タンデムセルでは非集光で 32%, 集光下では 40%の変換効率が達成されている。 この構造においては、太陽光スペクトルとの整合が 不十分であり、図 2(a)に示すように、トップセル、およ





研究紹介

びミドルセルでの電流生成量と比べて、ボトムセルで ある Ge 層において電流が過剰に生成されており、そ の過剰分の電流は使用されず損失となっている。こ のスペクトルのミスマッチを改善するため、これまで に様々な構造デザインが提案されてきた。近年では、 格子不整合系の製膜技術の進展に伴い図 2(b)に示 すような3 接合セルが高品質に作製されており、特に 図 2(b)下の構成において、非集光で37.9%、集光下で は44.4%が報告されている。3 接合タンデム構造で高 効率が実現されている一方、さらなる効率の向上の ためには接合数の増加が必須となる。

多接合化へのアプローチとして,我々は第3セル (黄色の層)に GaInNAs(Sb)を用いた格子整合系 4 接 合タンデム太陽電池の開発を進めている(図 2(c))。 この構造では、従来型の3 接合構造において過剰と なっている Ge セルでの電流生成を 1.0eV の第3 セル に分担させることによってスペクトルマッチを向上させ, 電圧を増加させることが可能となる。GaInNAs は,母 材料の GaAs に N 原子を添加することで格子定数を 縮小しながらバンドギャップを減少させる GaNAs と, In 添加により格子定数を拡大させつつバンドギャップ を減少させる GaInAs との化合物である。この GaInNAsを用いることで、図3に青で示す広い領域を カバーすることができる。この領域は, 従来の Ⅲ-V 化合物半導体で用いられる Al, Ga, In, P, As, Sb の 組み合わせでは実現することは不可能であり, GaNAs 混晶の発見による寄与が大きい。さらに, Inと Nの添加量を適切に制御することにより Ge と格子整 合させつつ 1.0eV のバンドギャップを得ることができ る。

GaInNAs の製膜方法として, 我々は分子線エピタ キシー (MBE)法を採用し高品質化の研究を進めてい る。窒素 (N₂) は化学的に安定な物質であるため, GaAs や GaInAs 材料にパーセントオーダーで N 原子 を添加するためには活性な窒素源が必要となる。一 般に, MBE 法では窒素ガスを高エネルギーのプラズ マ状態にして結晶成長表面に供給している。結晶成 長表面で単独の N 原子同士が凝集しやすいため, 結



図 3. III-V 化合物半導体の格子定数とバンドギャップの関係. GalnNAs は In と N の添加量を制御することにより青で示す 領域をカバーすることが可能. 赤線は GaAs や Ge との格子 整合を示す.



晶中に添加される際に空間的に不均一な N 原子分 布が生成されることが多い。このように N 原子が結晶 中に不均一に取り込まれることによって,結晶欠陥や, 伝導帯のポテンシャル揺らぎが生じ, GainNAs 結晶 の電気的特性や,光学的特性が劣化してしまう。した がって,太陽電池等へのデバイス応用のためには, N 原子の結晶中への導入を制御し,均一化させるこ とが重要となる。

図4には GaInNAs 太陽電池の分光感度特性を示





す。ここで、870nm 以上の長波長域のシグナルが GalnNAs 層によるキャリア収集成分である。GalnNAs では、結晶中の N の不均一分布や結晶欠陥等に起 因して少数キャリア拡散長が非常に短くなってしまう ため、(a)のような pn 接合構造では十分なキャリア収 集が得られない。したがって、低キャリア濃度のアン ドープ GalnNAs 層を導入することによって実効的な空 乏層幅を拡大することが有効である。(b)pin 構造のよ うに空乏層を拡大し、内蔵電界によってドリフト成分 を増加させることで、量子効率を著しく増大させること が可能である。一方、1eV 帯に向けて GalnNAs の N 組成を増加させると、(c)のように量子効率の低下が 起こってしまう。これは、N 組成の増加に伴い、N に起 因して導入される結晶欠陥や、伝導体ポテンシャル 揺らぎの影響が増加したためであると考えられる。

N 原子の均一な取り込みを実現するために, 我々 はアンチモン(Sb)をサーファクタントとして導入してい る。Sb 照射量を最適化することによって, 図 5 に示す ように, フォトルミネッセンス強度, および半値幅の改 善が得られることが分かった^[2]。さらに詳細に調べる ことにより, Sb 照射が N 原子導入によって生じる伝導 体のポテンシャル揺らぎを低減する効果があることを 明らかにした(図 6)^[2]。これは, Sb のサーファクタント 効果によってより均一な N 原子分布が実現されたた めであると考えられる。





この結晶成長技術を用いて作製したバンドギャップ 1.08eVのGalnNAsSb単接合太陽電池では変換効率 9.1%が得られ、また、GalnNAsSbの吸収波長領域に おける外部量子効率としては80%を達成した(図 6)^[3]。 このGalnNAsSbセルを4接合タンデム太陽電池に適 用した場合を想定すると、GalnNAsSbサブセルから 得られる短絡電流密度の値としては、10mA/cm²が 見積もられる。

さらに、我々はGeサブセル上にGaInNAsSbサブセ

ルを配置した 2 接合タンデム太陽電池の開発も進め ている。現状では、GaInNAsSb サブセルの量子効率 は 50~70%程度が得られており、タンデム太陽電池と して動作していることを確認している(図 8)。

前述のように、タンデム太陽電池全体に流れる電 流はそれぞれのサブセル間で最も小さい値に律速さ れる。4接合構造では、AM-1.5の太陽光スペクトルを 想定すると、12~14mA/cm²程度の電流が必要とな る。したがって、今後の課題として Ge サブセル上の GalnNAsSb サブセルの品質改善だけでなく、バンド端 の長波長化へのアプローチ、並びにデバイス構造の 最適化が重要となる。

参考文献

- [1]M.A. Green, K. Emery, Y. Hishikawa, W. Warta, and E.D. Dunlop, "Solar cell efficiency table (version 41)," Prog. Photovolt.: Res. Appl., vol. 21, 1-11 (2013).
- [2]N. Miyashita, N. Ahsan, and Y. Okada, "Effect of antimony on uniform incorporation of nitrogen atoms in GaInNAs films for solar cell application," Sol. Energ. Mat. Sol. Cells, vol. 111, 127-132 (2013).
- [3]N. Miyashita, N. Ahsan, M.M. Islam, and Y. Okada, "Device Structure Engineering of GaInNAsSb/GaAs Hetero-junction Solar Cells," Proc. IEEE 39th Photovoltaic Specialists Conference (PVSC), Tampa, June 2013.